УДК 621.793.182

КОРРОЗИОННЫЕ СВОЙСТВА ХРОМОВЫХ ПОКРЫТИЙ: РОЛЬ ПЛАЗМЕННОГО АССИСТИРОВАНИЯ ПРИ МАГНЕТРОННОМ РАСПЫЛЕНИИ

Д.В. Сиделёв, В.А. Грудинин, К.А. Алкенова Научный руководитель: доцент, к.т.н. Д.В. Сиделёв Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия, г. Томск, пр. Ленина, 30, 634050 E-mail: sidelevdv@tpu.ru

CORROSION PROPERTIES OF CHROMIUM COATINGS: EFFECT OF PLASMA ASSISTANCE FOR MAGNETRON SPUTTERING

D.V. Sidelev, V.A. Grudinin, K.A. Alkenova
Scientific Supervisor: Assistant Professor, PhD D.V. Sidelev
Tomsk Polytechnic University, Russia, Tomsk, Lenin av., 30, 634050
E-mail: sidelevdv@tpu.ru

Abstract. This paper describes an effect of plasma assistance on corrosion properties of chromium coatings obtained by magnetron sputtering. It was found that plasma assistance results in 2-5 times increase in polarization resistance depending on the type of sputtering target. The most pronounced effect of plasma assistance is observed for high-rate coating deposition using magnetron sputtering with a "hot" target.

Введение. Широко распространённым методом осаждения защитных хромовых покрытий является химическая технология (хромирование), однако, постепенно происходит отказ от технологий хромирования изделий из-за чрезвычайной высокой токсичности участвующих в процессе осаждения соединений [1]. Одним из наиболее перспективных альтернативных методов осаждения хромовых покрытий является магнетронное распыление. Преимуществами данного метода является экологичность, высокие плотность покрытий и адгезионная прочность. Однако, в сравнении с химической технологией, магнетронное распыление значительно уступает в производительности процесса осаждения. Одним из подходов, позволяющих значительно увеличить (вплоть до одного порядка величины) скорость осаждения покрытий, является использование сублимирующей («горячей») хромовой мишени. В таком случае, дополнительно к процессу распыления мишени происходит сублимация её поверхности. Перспективность такого подхода в целях увеличения производительности осаждения уже была показана в ряде публикаций [2-4]. Однако, применение «горячей» Сг мишени, как правило, приводит к ухудшению функциональных свойств покрытий, в том числе и к коррозионной стойкости. Основная причина снижения параметров свойств покрытий состоит в том, что дополнительный поток атомов за счёт сублимации имеет низкую кинетическую энергий (менее 0,3 эВ) в сравнении с распылёнными атомами. Возможным решением может быть применение плазменного ассистирования процессу магнетронного распыления дополнительным внешним источникам, которое позволяет увеличить плотность ионного тока, поступающего на подложку, и, таким образом, регулировать свойства покрытий [5-7]. Например,

применение высокочастотного источника индуктивно-связанной плазмы в процессе магнетронного распыления [7].

Цель настоящей работы состоит в исследовании влияния плазменного ассистирования на коррозионную стойкость хромовых покрытий, полученных при помощи магнетронного распыления.

Экспериментальная часть. В качестве подложек для исследования коррозионной стойкости хромовых покрытий использовалась сталь марки 12х18н10т. Схема осаждения покрытий подробно рассматривается в работе [8]. В эксперименте использовались две конструкции магнетронной распылительной системы (МРС): с «горячей» и охлаждаемой мишенью. Остаточное давление в вакуумной камере составляло 5·10⁻³ Па, а рабочее давление — 3·10⁻¹ Па. Плотность мощности при осаждении покрытий была равна 15,7 Вт/см² и была подобрана таким образом, чтобы плотность потока сублимированных частиц в случае распыления «горячей» мишени была соразмерна распылённому потоку. Время осаждения покрытий при распылении «горячей» мишени — 60 мин, охлаждаемой - 120 мин. Толщина полученных покрытий была равна 2,4±0,2 мкм. В качестве дополнительного внешнего плазменного источника использовался радиочастотный плазменный генератор РПГ-128 (ООО «Лаборатория плазменных технологий плюс», г. Зеленоград, Россия), подключенный к источнику питания СОМDEL СХ1250 с частотой 13,56 МГц. Мощность РПГ-128 во всех экспериментах - 500 Вт.

Для исследования коррозионной стойкости покрытий применялся метод потенциодинамической поляризации в растворе 3,5 масс.% NaCl, упрощённо имитирующий условия морской воды. Испытания осуществлялись при использовании потенциостата-гальваностата P-45X (Electrochemical Instruments, г. Черноголовка, Россия) в классической трёхэлектродной электрохимической ячейке. В качестве электрода сравнения использовался Ag/AgCl электрод. Противоэлектродом выступал графитовый стержень. Перед проведением основного испытания поверхность испытуемого образца выдерживалась в электролите при потенциале разомкнутой цепи в течение 2000 секунд для компенсации зарядов.

Результаты исследований. На рисунке 1 представлены результаты проведения коррозионных испытаний для хромовых покрытий, полученных при магнетронном распылении охлаждаемой и «горячей» мишеней в присутствии/отсутствии ассистирования РПГ-128.

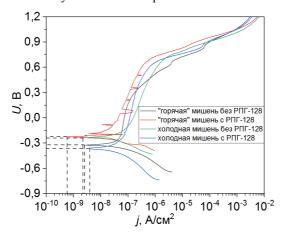


Рис. 1. Потенциодинамические кривые, полученных для Cr покрытий в зависимости от конфигурации мишени и плазменного ассистирования

Полученные потенциодинамические кривые были проанализированы методом Штерна-Гири, исходя из которых, получены значения сопротивления поляризации полученных покрытий (таблица 1).

Таблица 1

| Электрохимические | параметры | полученных | покрытий |
|-------------------|-----------|------------|----------|

| Образец | <i>U</i> , B | j, ·10 ⁻⁹ А/см ² | R_p , MOm·cm ² |
|-----------------------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------|
| «горячая» + РПГ-128 | -223,5 | 3,6 | 10,7 |
| холодная + РПГ-128 | -358,9 | 17,7 | 11,1 |
| «горячая» без РПГ-128 | -324,9 | 24,5 | 2,3 |
| холодная без РПГ-128 | -233,8 | 27,5 | 5,9 |

Таким образом, покрытия, полученные в условиях плазменного ассистирования, показали наилучшее сопротивление коррозии, как в случае распыления «горячей», так и охлаждаемой мишени. Без плазменного ассистирования наблюдается значительная разница в сопротивлении поляризации для хромовых покрытий (в 2,6 раз), что указывает на значимую роль применения РПГ-128 для модификации коррозионных свойств осаждаемых покрытий.

Заключение. Выявлено, что плазменное ассистирование приводит к увеличению сопротивления поляризации в 2-5 раз в зависимости от типа применяемой мишени. Более значимый эффект наблюдается в случае «горячей» мишени, когда скорость осаждения выше. Были выявлено, что наиболее высокую коррозионную стойкость в растворе 3,5 масс.% NaCl имеют именно такие покрытия, что подтверждает перспективность и применимость данного подхода для компенсации ухудшения функциональных характеристик покрытий, полученных при магнетронном распылении «горячей» мишени.

Исследование выполнено в рамках выполнения гранта Президента $P\Phi$ (проект № MK-3570.2022.4).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- 1. Miretzky P. et al. Cr(VI) and Cr(III) removal from aqueous solution by raw and modified lignocellulosic materials: a review // Journal of Hazardous Materials. 2010. Vol. 180, iss 1-5. pp. 1-19.
- 2. Sidelev D.V. et al. High-rate magnetron sputtering with hot target // Surface and Coatings Technology. 2010. Vol. 308. pp. 168-173.
- 3. Mercs D. et al. Hot target sputtering: a new way for high-rate deposition of stoichiometric ceramic films // Surface and Coatings Technology. 2006. Vol. 301. pp. 2276-2281.
- 4. Billard A. et al. Influence of the target temperature on a reactive sputtering process // Surface and Coatings Technology. 1999. Vol. 116-119. pp. 721-726.
- 5. Voevodin A.A. et al. Wear resistant composite coatings deposited by electron enhanced closed field unbalanced magnetron sputtering // Surface and Coatings Technology. 1995. Vol. 73. pp. 185-197.
- 6. Zhen He et al. Effect of bias on structure mechanical properties and corrosion resistance of TiN_x films prepared by ion source assisted magnetron sputtering // Thin Solid Films. 2019. Vol. 676. pp. 60-67.
- 7. V. Stranak et al. Highly ionized physical vapor deposition plasma source working at very low pressure // Applied Physics Letters. 2012. Vol. 100. article number 141604.
- 8. Grudinin V.A. et al. Hot target magnetron sputtering enhanced by RF-ICP source for CrN_x coatings deposition // Vacuum. 2021. Vol. 191. article number 110400.